



00270

PATENT TRADEMARK OFFICE

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2001年5月31日 (31.05.2001)

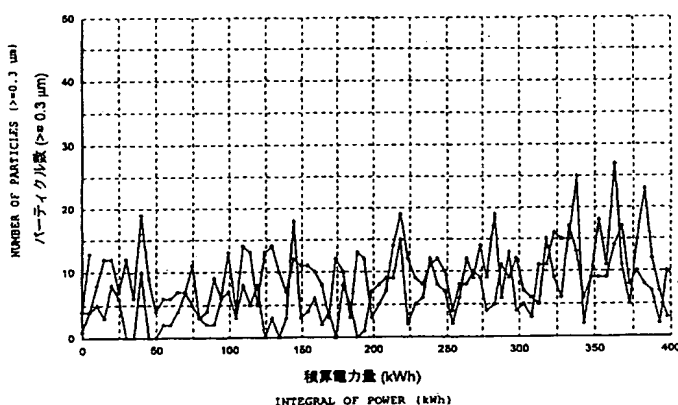
PCT

(10) 国際公開番号  
WO 01/38598 A1

- (51) 国際特許分類: C23C 14/34 (72) 発明者; および  
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 福世秀秋 (FUKUYO, Hideaki) [JP/JP], 新藤裕一朗 (SHINDO, Yuichiro) [JP/JP], 高橋秀行 (TAKAHASHI, Hideyuki) [JP/JP]; 〒319-1535 茨城県北茨城市華川町日場187番地4 株式会社 日鉱マテリアルズ 磯原工場内 Ibaraki (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP00/07411
- (22) 国際出願日: 2000年10月24日 (24.10.2000)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願平 11-331073  
1999年11月22日 (22.11.1999) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 日鉱マテリアルズ (NIKKO MATERIALS COMPANY, LIMITED) [JP/JP]; 〒105-8407 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): JP, KR, US.
- 添付公開書類:  
— 国際調査報告書
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: TITANIUM TARGET FOR SPUTTERING

(54) 発明の名称: スパッタリング用チタンターゲット



(57) Abstract: A titanium target for sputtering, characterized in that it contains oxygen in an amount of 20 ppm or less and it has a maximum grain diameter of 20  $\mu\text{m}$  or less. The target allows a sputtering being substantially free from the formation of particles or the occurrence of an abnormal discharge phenomenon, is reduced in the content of contaminants, and is soft.

(57) 要約:

スパッタリング用チタンターゲットに含有する酸素の不純物濃度が20 ppm以下、該ターゲットの最大結晶粒径が20  $\mu\text{m}$ 以下であるスパッタリング用チタンターゲットに関し、パーティクルや異常放電現象が発生せず、汚染物質が少なく、かつ軟質のスパッタリング用チタンターゲットを提供する。

00270 9296001

WO 01/38598 A1